บรรณานุกรม

จตุพร วุฒิกนกกาญจน์. (2542). การศึกษาสภาพพื้นผิวของโพลิเมอร์โดยใช้เทคนิค Atomic Force Microscopy. *Materials characterization*, 46-50.

ชัยยุทธ ช่างสาร และเลิศณรงค์ ศรีพนม. (2545). กรุงเทพ ฯ: ว. เพ็ชรสกุล.

ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์. (2544). *การสร้างและศึกษาลักษณะของอิเลคโทรดประเภทฟิล์มบางโปร่งแสง*, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีและวัสดุ, คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ธีระวิทย์ ดีเลิศ. (2550). *โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี สปัตเตอริง*, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริงตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. *รายงานการวิจัยประจำปี 2547. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม* (หน้า 163-166). กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

มติ ห่อประทุม. (2548). *การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

อดิศร บูรณวงศ์. (2551). *สภาพชอบน้ำของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ ที่เตรียมด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี สปัตเตอริง*, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาฟิสิกส์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Akari, S. (2001). *Tapping Mode Mikroskopie*. Retrieved January 15, 2009, from http://www.nanocraft.de/kompetenz/tapping/tapping.html

Acosta, D. R., Martinez, A. I., Lopez, A., & Magana, C. R. (2005). Titanium Dioxid Thin Films: the Effect of the Preparation Method in Their Photocatalytic Properties. *JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS*, *228*, 183-188.

Bally, A. R., Hones, P., Sanjines, R., Schmid, P. E., & Levy, F. (1998). Mechanical and Electrical Properties of FCC TiO_{1+x} Thin Film Prepared byR.F. Reactive Sputtering. *Surface and Coatings Technology*, *108*, 166-170.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Barnes, M.C., Kumar, S., Green, L., Hwang, N.M., & Gerson, A.R. (2005). The Mechanism of Low Temperature Deposition of Crystalline Anatase by Reactive DC Magnetron Sputtering. *Surface and Coatings Technology, 190*, 321-330.

Bunshah, R. F. (1994). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings*. (2nd ed.). New Jersey: Noyes.

Carneiro, J.O., Teixeira, V., Portinha, A., Dupak, L., Magalhaes, A., & Coutinho, P. (2005). Study of the Deposition Parameters and Fe-Dopant Effect in the Photocatalytic Activity of TiO_2 Films Prepared by DC Reactive Magnetron Sputtering. *Vacuum, 78,* 37–46.

Center for Computational Materials Science. (2002). *Materials Science and Thechnology*. Retrieved July 25, 2009, from http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk.picts/c4.s.png

Chapman, B. (1980). *Glow Discharge Processes*. New York: John Wiley & Sons.

Dumitriu, D., Bally, A.R., Ballif , A. C., Hones, P., Schmid, P.E., Sanjinés, R., Lévy, F., & Pârvulescu, V.I. (2000). Photocatalytic Degradation of Phenol by TiO_2 Thin Films Prepared by Sputtering. *Applied Catalysis B: Environmental, 25,* 83–92.

Ecosoft Systems Inc. Asia Limited. (2003). Retrieved October 11, 2009, from http://www.ecosoftsystem.com/english_site/ultraViolet.htm

EnConLAB. (2545). *การผลิตนำเข้าและจำหน่ายกระจก: สถานภาพการผลิตกระจกของไทย* .วันที่ค้นข้อมูล 10 เมษายน 2551, เข้าถึงได้จาก http://www.enconlab.com/high_performance /file_download /supplier/supplier_mirror.pdf

GlassonWEb. special glass. (2006, May). *Self-Cleaning glass*. Retrieved July 11, 2009, from www.glassonweb.com/glassmanual/topics/index/selfclean.html

Guan, K. (2005). Relationship Between Photocatalytic Activity, Hydrophilicity and Self-Cleaning Effect of TiO_2/SiO_2 Films. *Surface & Coatings Technology, 191*, 155-160.

Hunsche, B., Vergohl, M., & Ritz, A. (2006). Investigation of TiO_2 Based Thin Films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering for Use At High Temperature. *Thin Solid Fils*, *502*, 188-192.

Jin, P., Miao, L., Tanemura, S., Xu, G., Tazawa, M., & Yoshimura, K. (2003). Formation and Characterization of TiO_2 Thin Films with Application to a Multifunctional Heat Mirror. *Applied Surface Science, 212-213*, 775-781.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Jing, S., Wei, L., & Yongfa, Z. (2003). Structure and photocatalytic characteristics of TiO_2 film photocatalyst coated on stainless steel webnet. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 202,* 187–195.

Kathirvelu, S., Souza, L., & Dhurai, B. (2008). Nanotechnology Applications in Textiles. *Indian Journal of Science and Technology*, *1*, 1-10.

Kim, D. J., Hahn, S. H., Oh, S. H., & Kim, E. J. (2002). Influence of Calcinations Temperature on Structural and Optical Properties of TiO_2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Dip Coation. *Materials Letter, 57*, 355-360.

Kristallogr, Z., Kristallgeom, Z., Kristallphys, Z., & Kristallchem, Z. (1942). Crystal Structure Communications. *Crystallographica Section C*, *104*, 358.

Kristallogr, Z., Kristallgeom, Z., Kristallphys, Z., & Kristallchem, Z. (1972). Crystal Structure Communications. *Crystallographica Section C, 136*, 273.

Lakshmi, S., Renganathan, R., & Fujita, S. (1995). Study on TiO_2-Mediayed Photocatalytic Degradation of Methylene Blue. *Journal of Photochemistry and Photobiology*, *88*, 163-167.

Liu, Baoshun., Zhou, X., Zhou, Q., Li, Chunling., & He, X. (2005). The Effect of partial Pressure on the Structure and Photocatalytic Property of TiO_2 Films Prepared by Sputtering. *Materials Chemistry and Physics*, *90*, 207-212.

Maissel, L. I., & Glang, R. (1970). *Handbook of Thin Film Technology*. New York: Mc Graw-Hill Book Company.

Munz, W. D. (1991). The Unbalanced Magnetron : Current Status of Development. *Surface and Coatings Technology, 48*, 81-94.

Ogawa, H., Higuchi, T., Nakamura, A., Tokita, S., Miyazaki, D., Hattori, T., & Tsukamoto, T. (2008). Growth of TiO_2 Thin Film by Reactive RF Magnetron Sputtering Using Oxygen radical. *Journal of Alloys Compounds*, *499*, 735-378.

Okimura, K., Shibata, A., Maeda, N., Tachibana, K., Noguchi, Y., & Tsuchida, K. (1995). Preparation of Rutile TiO_2 Films by RF Magnetron Sputtering. *Jpn. J. Appl. Phys.*, *34*, 4950-4955.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Okimura, K., Maeda, N., & Shibata, A. (1996). Characteristics of Rutile TiO_2 Films Prepared by R.F. Magnetron sputtering at A Low Temperature. *Thin Solid Films*, *281-282*, 427-430.

POLITECNICO DI TORINO. (2007, December) *Scanning Probe microscopy*. Retrieved Decembrer 10, 2008, from POLITECNICO DI TORINO Web site: http://www2.polito.it/ricerca/micronanotech/Strumentu/SPM.html

Rickerby, D. S., & Matthews, I. (1991). *Advanced Surface Coating: a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

Rizzo, L., Koch, J., Belgiorno, V., & Anderson, M. A. (2007). Removal of Methylene Blue in A Photocatalytic Reaction Using Polymethylmethacrylate Supported TiO_2 Nanafilm. *DESALINATION*, *211*, 1-9.

Rohde, S. L., & Munz, W. D. (1991). *Sputter Depostion in Advanced Surface Coatings : A Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

SAINT GOBAIN GLASS, *Self-cleaning glass*. (2007). Retrieved July 11, 2009, from SAINT GOBAIN GLASS Web site: http://www.saint-gobain-glass.com/exen/a2.html

Satoshi, T., Susumu, S., & Hidefumi, D. (2001). Photocatalytic TiO_2 Thin Films Deposited onto Glass by DC Magnetron Sputtering. *Thin Solid Films, 393*, 136-140.

Shang, J., Li, W., & Zhu, Y. (2003). Structure and Photocatalytic Characteristics of TiO_2 Film Photocatalyst Coated on Stainless Steel Webnet. *Journal of Molecular Catalysis A*, *202*, 187-195.

Smith, D. L. (1995). *Thin-Film Deposition : Principle And Practice.* New York: McGraw-Hill.

Song, P. K., Irie, Y., & Shigesato. Y. (2006). Crystallinity and Photocatalytic Activity of TiO_2 Films Deposited by Reactive Sputtering with Radio Frequency Substrate Bias. *Thin Solid Films, 496*, 121–125.

Sproul, W. D. (1992). Unbalanced Magnetron Sputtering. 35th Annual Technical Conference Proceedings. *Society of Vacuum Coaters*, 236-239.

Syarif, D. G., Miyashita, A., Yamaki, T., Sumita, T., Choi, Y., & Itoh, H. (2002). Preparatin of Anatae and Rutile Thin Film by Controlling Oxygen Partial Pressure. *Applied Surface Science*, *193*, 287-292.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Szczyrbowski, J., Brauer, G., Ruske, M., Bartella, J., Schroeder, J., & Zmelty, A. (1999). Some Properties of TiO_2 Layers Prepared by Medium Frequency Reactive Sputtering. *Surface and Coatings Technology*, *112*, 261-266.

Takahashi, H., & Nakabayashi, H. (2002). Dependence of working gas pressure and ratio of Ar to O_2 on properties of TiO_2 film depositied by facing targets sputtering. *Thin solid film, 420-421,* 433-437.

Takeda, S., Susumu, S., Odaka, H., & Hososno, O. H. (2001). Photocatalytic TiO_2 Thin Films Deposited onto Glass by DC Magnetron Sputtring. *Thin Solid Films*, *392*, 338-344.

Tavares, C.J., Vieira, J., Rebouta, L., Hungerford, G., Coutinho, P., Teixeira, V., Carneiro, J.O., & Fernandes, A.J. (2007). Reactive sputtering deposition of photocatalytic TiO2 thin films on glass substrates. *Materials Science and Engineering, 138,* 139–143.

Tazawa, M., Okada, M., Yoshimura, K., & Ikezawa, S. (2004). Poto-catalytic Heat Mirror with a Thick Titanium Dioxide Layer. *Solor Energy Materials & Solar Cells*, *84*, 159-170.

Titanium-oxide photocatalyst. (2004, Jan 1). *Three Bond Technical News*, *62*, p. 2

Toku, H., Pressoa, R.S., Maciel, H.S., Massi, M., & Mengui, U.A. (2008). The Effect of Oxygen Concentration on the Low Temperature Deposition of TiO_2 Thin Film. *Surface coatings and technology, 202,* 2126-2131.

UNSW ANALYTICAL CENTRE. (2007). *Digital Instruments 3000 AFM*. Retrieved October 17, 2008, from http://srv.emunit.unsw.edu.au/facility/afm.htm

Vossen, J. L., & Kerns, W. (1978). *Thin Films Processes*. New York: Academic Press.

Wang, T.M., Zheng, S.K., Hao, W.C., & Wang, C. (2002). Studies on photocatalytic activity and transmittance spectra of TiO_2 thin film prepared by r.f. magnetron sputtering method. *Surface and Coatings Technology, 155,* 141-145.

Wu, K.R., Wang, J.J, Liu, W.C., Chen, Z.S., & Wu, J.K. (2006). Deposition of Graded TiO_2 Films Featured Both Hydrophobic and Photo-Induced Hydrophilic Properties. *Applied surface* Science*, 255*, 5829-5838.

Yamagishi, M., Kuriki, S., Song, P.K., & Shigesato, Y. (2003). Thin Film TiO_2 Photocatalyst Deposited by Reactive Magnetron Sputtering. *Thin Solid Films, 442*, 227-231.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Yi, Z., Guofeng, C., Ma, W., & Wei, W. (2008). Eeffect of External Bias Voltage and Coating Thickness on the Photocatalytic Activity of Thermal Spayed TiO_2 Coating. *Progress in Organic Coating*, *61*, 321-325.

Zeman, P., & Takabayashi, S. (2002). Effect of Total and Oxygen Partial Pressures on Structure of Photocatalytic TiO_2 Films Sputtered on Unheated Substrate. *Surface and Coatings Technology*, *153*, 93-99.

Zeman, P., & Takabayashi, S. (2003). Nano-Scaled Photocatalytic TiO_2 Thin Films Prepared by Magnetron Sputtering. *Thin Solid Films*, *433*, 57-62.

Zhao, X.T., Sakka, K., Kihara, N., Takada, Y., Arita, M., & Masuda, M. (2005). Structure and Photo-Iinduced Features of TiO_2 Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering. *Microelectronics Journal*, *36*, 549-551.

Zheng, S.K., Wang, T.M, Xiang, T.M., & Wang, C. (2001). Photocatalytic Activity of Nanostructured TiO_2 Thin Films Prepared by DC Magmetron Sputtering Method Deposited by Reactive Magnetron Sputtering. *Vacuum, 62*, 361-366.

Zywitezki, O., Modes, T., Frach, P., & Gloss, D. (2008). Effect of Structure and Morphology on Photocatalytic Properties of TiO_2 Layers. *Surface & Coating Technology*, *202*, 2488-2493

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University